

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 奈良安雄 副委員長 大野裕三

幹事 笹子佳孝 幹事補佐 黒田理人

★有機エレクトロニクス研究会 (OME)

専門委員長 加藤景三 副委員長 松田直樹

幹事 森 竜雄・瀧本 清 幹事補佐 鴻野晃洋・井上振一郎

日時 4月10日(木) 13:30~17:00

11日(金) 9:00~11:30

会場 沖縄県青年会館(那覇市久米2-15-23. モノレール旭橋駅下車徒歩5分. <http://www.okiseikan.or.jp/> TEL
〔092〕802-3737 佐道泰造(九大))

議題 薄膜(Si, 化合物, 有機, フレキシブル)機能デバイス・材料・評価技術, バイオテクノロジー, 及び一般
10日

1. ソリユーションプラズマ法によるグラフェンの親水化
内野聖子・大竹亜紗美・滝澤 登(佐賀大)・中島達朗・松田直樹(産総研)・江良正直・○坂口幸一(佐賀大)
2. ホスホン酸自己組織化単分子膜によるITO電極上でのチトクロームcの固定化と直接電子移動反応
○松田直樹・岡部浩隆(産総研)
3. [招待講演] メニスカス力を用いた単結晶シリコン薄膜転写技術とそのデバイス応用
○東 清一郎・酒池耕平・赤澤宗樹・中村将吾(広島大)
4. フレキシブルエレクトロニクス創成に向けた金誘起層交換成長法による擬似単結晶Ge/プラスチックの形成
○パク ジョンヒョク・宮尾正信・佐道泰造(九大)
5. 非晶質Ge薄膜のAu誘起成長に及ぼす電子線照射の影響
○茂藤健太・崎山 晋・酒井崇嗣・中嶋一敬・高倉健一郎・角田 功(熊本高専)
6. [招待講演] 非晶質絶縁体上における大粒径Ge(111)薄膜のAl誘起低温成長
○都甲 薫・末益 崇(筑波大)
7. 絶縁膜上のAl誘起成長Ge層に与える基板効果とフレキシブル基板応用
○大谷直生・都甲 薫・沼田諒平・中沢宏紀(筑波大)・宇佐美徳隆(名大)・末益 崇(筑波大)
8. Al誘起成長法による大粒径Ge/導電膜/ガラス構造の形成
○中沢宏紀・都甲 薫(筑波大)・宇佐美徳隆(名大)・末益 崇(筑波大)
9. Si(111)基板上BaSi₂エピタキシャル膜の結晶・光学特性評価とガラス基板上への展開
○高部涼太・都甲 薫・沼田諒平(筑波大)・原 康祐(名大)・馬場正和・Weijie Du(筑波大)・宇佐美徳隆(名大)・末益 崇(筑波大)

11日

1. [招待講演] 大粒径薄膜poly-Siを利用したガラス上低温poly-Si TFTの高性能化
○原 明人・加茂慎哉・佐々木 駿・目黒達也(東北学院大)・佐藤 旦(広島大)・北原邦紀(島根大)
2. ダブルラインビーム連続発振レーザラテラル結晶化による高性能poly-Si TFT
○山野真幸・黒木伸一郎・佐藤 旦(広島大)・小谷光司(東北大)・吉川公磨(広島大)
3. [招待講演] 多結晶シリコン薄膜の低温成長に関する研究—高性能フレキシブルディスプレイ実現に向けて—
○河本直哉・只友一行(山口大)・部家 彰・松尾直人(兵庫県立大)
4. O₂混合Arスパッタにより室温成膜したSiO₂膜の電気特性評価
井村公彦・○岡田竜弥・下田清治・杉原弘也・野口 隆(琉球大)
5. BLDAを用いた低温プロセスでのpoly-Si TFTの作製
○下田清治・杉原弘也・井村公彦・岡田竜弥・野口 隆(琉球大)
6. ブルーマルチレーザダイオードアニールを施したガラス上Si薄膜の光伝導特性
○コスワッタゲー チャリット ジャヤナダ・知念 伶・杉原弘也・岡田竜弥・野口 隆(琉球大)

◎10日の研究会終了後、懇親会を予定していますので御参加下さい。

☆SDM研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

6月19日(木) 名大ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー [4月9日(水)] テーマ: MOSデバイス・メモリ高性能化—材料・プロセス技術(応用物理学会; シリコンテクノロジー分科会合同開催)

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

☆OME研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

6月20日(金) 機械振興会館 [4月14日(月)] テーマ: 材料デバイスサマーミーティング

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

森 竜雄（愛知工大）

E-mail：t2mori@aitech.ac.jp

瀧本 清（キヤノン）

E-mail：takimoto.kiyoshi@canon-elec.co.jp